

## ZVÍDITELNÉ DISLOKACI LEPTÁNÍM V MONOKRYSTALECH $\text{NaNO}_3$

### VÝSLEDKY

MILENA PERINOVÁ, Bratislava

### ÚVOD

Selektivní leptání povrchu krystalu je jedna z nejrozšířenějších metod studia jejich dislokační struktury. Přehled leptadel, používaných pro celou řadu materiálů, je uveden v práci [1]. Pro studium iontových krystalů je tato metoda zvláště vhodná, protože je možno nalepat čisté dislokace, aniž by bylo třeba je dekorovat, jak je tomu u krystalů kovů a kromě toho se tímto způsobem dá sledovat pohyb dislokací.

Při leptání se rozpoňstějí přednostně místa, v okolí poruchy mřížky, jakou je např. dislokace, a vytvoří se leptová jama. Její tvar závisí na krystalo-grafii rozpouštěné látky a na složení leptadla. Teorii leptání se zabývali Cabrera [2, 3, 4] a Hirth a Pound [5]. Leptání iontových krystalů je popsáno v pracích Gilmana a Johnstona [6], Amelinckxe [7], Urusovské [8], Rožanského [9] a Kostina a Lubenceva [10]. Na základě jejich experimentálních prací lze odvodit některé obecné požadavky na leptadlo:

1. *základ leptadla tvorí látka, v níž je leptaná látka málo rozpustná (0,07 až 0,02 g/100 cm<sup>3</sup>),*

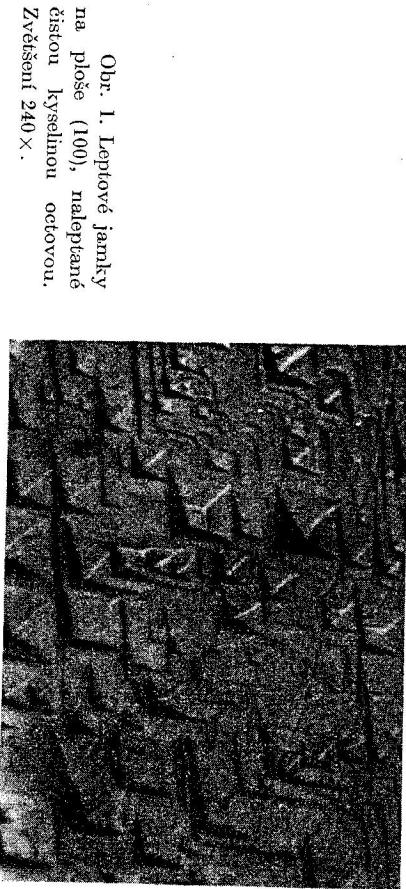
2. *kationy přiměsi dodávané do leptadla se nemají lišit od kationu leptané látky více než o 12—15 %,*

3. *kationy přiměsi má s aniontem leptané látky tvorit buď stabilní komplexy nebo málo rozpustné soli.*

Tyto podmínky však platí jen velmi zhruba a při hledání leptadla pro určitou látku je třeba postupovat vždy více méně experimentálně.

Dusičnan sodný, iontový krystal s romboedrickou mřížkou, je z hlediska studia mechanických vlastností krystalů velmi zajímavou látkou. Je o něm známo, že se za laboratorní teploty deformuje dvojčetním, jak však bylo zjištěno leptáním dochází v něm nejen ke dvojčetnímu, ale i ke skluzu [11]. V předložené práci bude popsáno leptadlo zviditelnující východy dislokací některých čar, a to pro štěpné plochy (100) a pro plochy (111), které byly ze štěpných

tvaru získané mechanickým leštěním. Leptadlo dovoluje rozlišit mezi růstovými a čerstvě zavedenými dislokacemi. Pro obě plochy byly nalezeny i vhodné leštěcí roztoky, rovnoměrně rozpouštějící celý povrch krystalu.



Obr. 1. Leptové jamky na ploše (100), naleptané čistou kyselinou octovou. Zvětšení 240×.

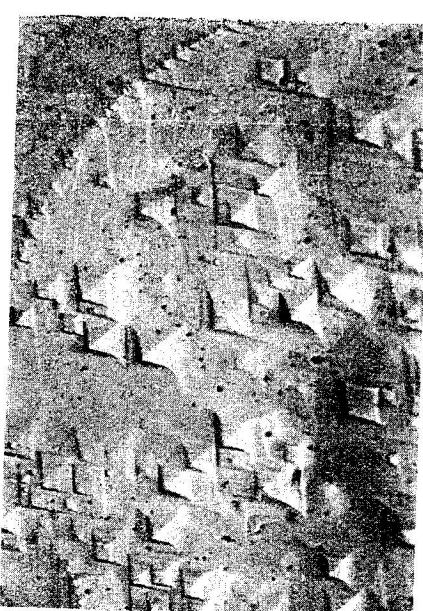
Poněvadž rozpustnost  $\text{NaNO}_3$  v ledové kyselině octové je ještě poměrně velká (asi 0,4 g/100 cm<sup>3</sup> při 27 °C) byly do čisté kyseliny přidávány různé přiměsi v několika koncentracích a sledován jejich vliv na tvar a velikost jamek. Obr. 2 ukazuje leptové obrazce vzniklé leptáním nasycenými roztoky  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{CoSO}_4$ ,  $\text{CdCH}_2\text{COO}$ ,  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$  a  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ . Velké koncentrace přiměsi značně zvětšují rozměry jamek a rovněž mění jejich tvar. Přidávání samotného  $\text{NaNO}_3$  rovněž zvětšuje rozměry jamek. Při malých koncentracích nejsou rozdíly ve tvaru jamek pro jednotlivé přiměsi, mění se však kontrast jamek podle toho, jak která příměs ovlivňuje tangenciální rychlosť leptání. Jako nejhodnější byla vybrána příměs  $\text{CoSO}_4$  v koncentraci 4 ml nasyceného roztoku  $\text{CoSO}_4$  v kyselině na I kyselinu.

Leptání ovlivňuje i řada dalších skutečností:

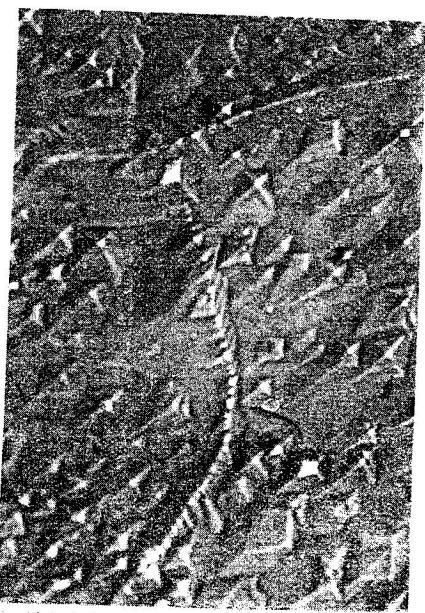
Obr. 2a.



Obr. 2b.



Obr. 2d.



Obr. 2e.

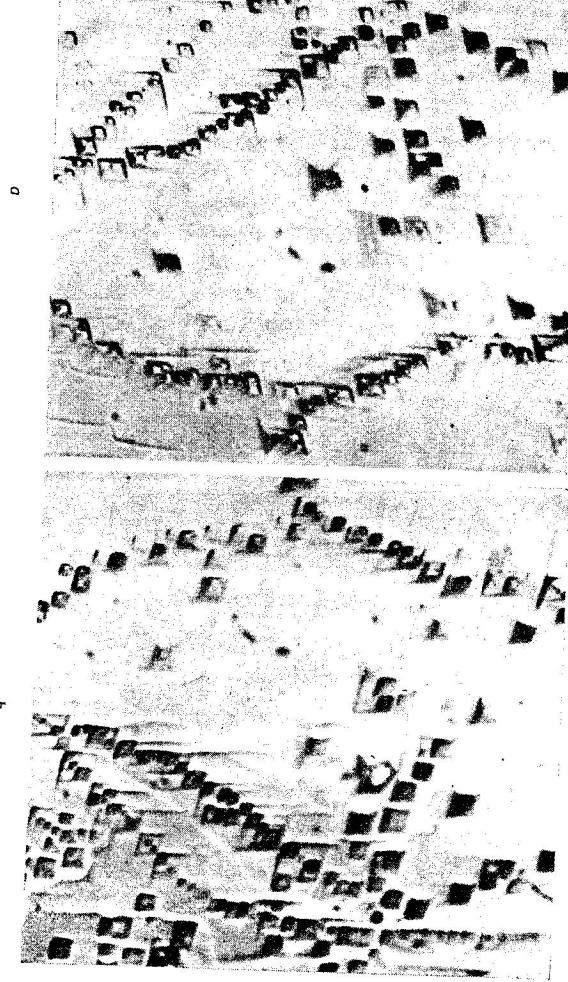


Obr. 2c.

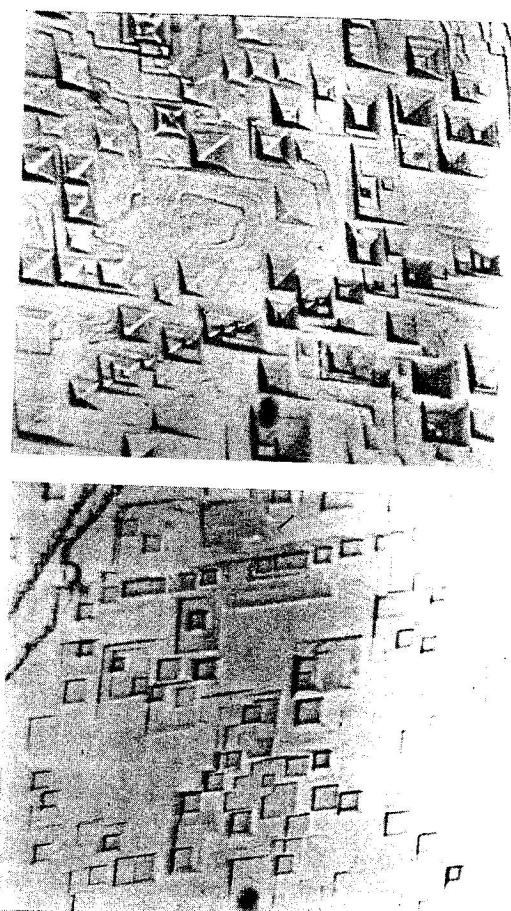
Obr. 2. Vliv přemění v ledové kyselině octové na tvar a velikost jamek. Leptáno 30 s nasycenými roztoky solí: a)  $\text{CaCO}_3$ , b)  $\text{CoSO}_4$ , c)  $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ , d)  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ , e)  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ . Zvětšení 240  $\times$ .

1. velikost v ovzduší velmi ztěžuje leptání. Vhodné podmínky jsou při relativní vlhkosti 40—50 %. Stoupne-li relativní vlhkost nad 70 % nedá se leptat.
2. přítomnost vody v leptadle zvětšuje tangenciální rychlosť leptání. Jamky se stávají větší, zaoblené a mělké. Roztok, v němž byl poměr vody a kyseliny 1 : 10, neleptal vůbec.
3. míchání ovlivňuje tvar jamek. Je-li vzorek v leptadle ponechán v klidu, naleptají se jamky s plochým dnem (obr. 3).
4. doba leptání — neoptimálnější doba leptání je 30 s.

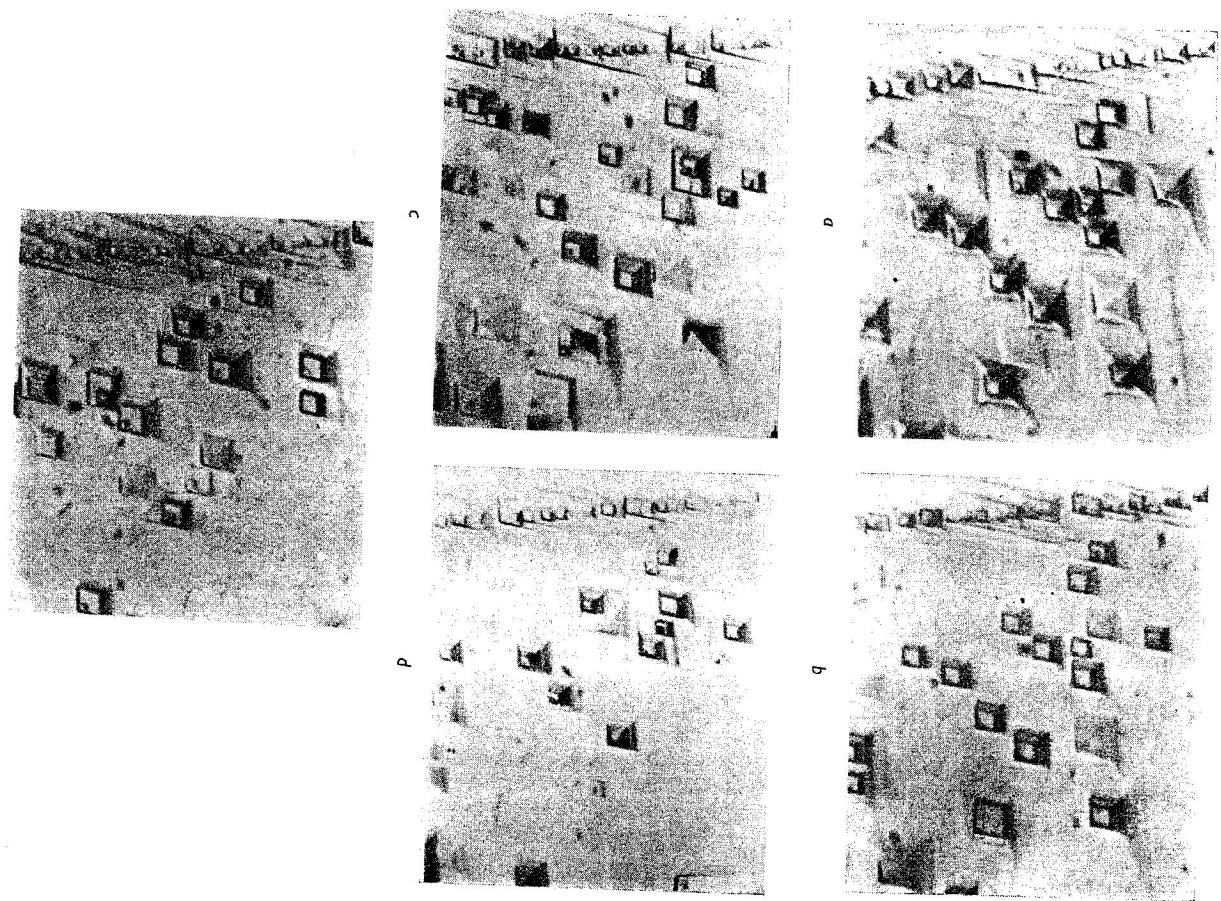
Obr. 4. Nalepáné dvě odpovídající si štěpné plochy. Zvětšení 375×.



Obr. 3. Vliv míchání na tvar leptových jamek: a) s vzorkem v rozítku pohybováno, b) vzorek klidný. Leptáno 30 s, zvětšení 240×.



Obr. 5. Leptání dislokací do hloubky: a) povrch krystalu. Další lepty v hloubkách b) 1,5 μ, c) 5 μ, d) 10 μ, e) 17 μ.



Abychom se přesvědčili, že leptové jamky skutečně přísluší dislokacím, naleptali jsme dvě odpovídající si čerstvé štěpné plochy. (Obr. 4.) Vidíme, že skutečně ke každé jamečce na levé ploše lze nalézt odpovídající jamku na pravé polovičce, jde tedy o čarové poruchy, procházející krystalem. Tento výsledek byl potvrzen i leptáním do hloubky. Po odleštění vrstvy z povrchu a opětovném naleptání vidíme stejný obraz rozložení jamek (obr. 5).

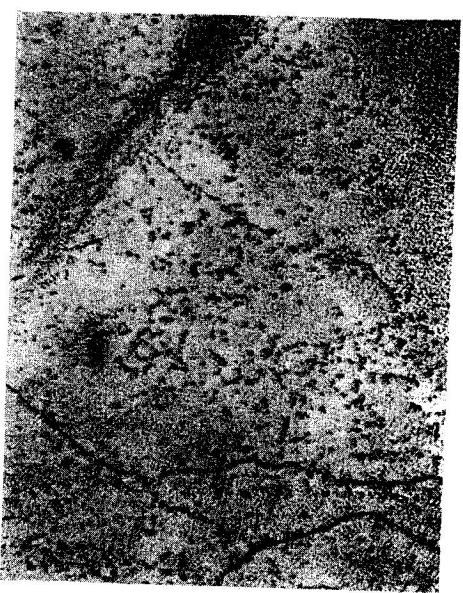
Ve všech těchto případech se jedná o růstové dislokace, přítomné v krystalech pěstovaných z taverniny. Mechanickým poškozením vznikají však v  $\text{NaNO}_3$  nové dislokace o jejichž kluzných rovinách a směrech pojednává práce [11]. Uvedené leptadlo umožňuje rozlišit mezi růstovými a novými dislokacemi. Jamky naleptané na čerstvých dislokacích jsou daleko menší, při optimální době leptání 8–10 s (obr. 6). Dislokační struktura krystalu  $\text{NaNO}_3$  byla

Obr. 6. Naleptaný povrch kolem vřichu, způsobeného diamantovým hrotom mikrovrdoméru silou 40 g. Vzorek předleptán 30 s, po vyvolení rozetky leptán dalších 30 s. Nové jamky znatelně menší než růstové. Zvětšení 100×.



Obr. 7a. Ukázka leptání plochy (111). Zvětšení 100×.

Obr. 7b. Dislokační struktura naleptaná na plochu (111). Růstové dislokace, hranice zrn, nové dislokace vzniklé okolo škrábance. Zvětšení 100×.



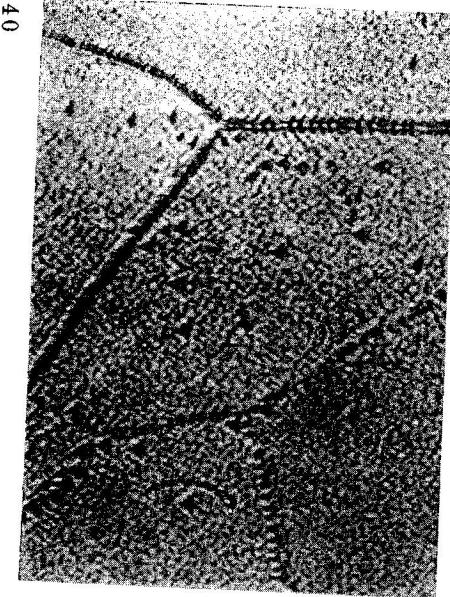
vrcholek vřichu, způsobeného diamantovým hrotom mikrovrdoméru silou 40 g. Vzorek předleptán 30 s, po vyvolení rozetky leptán dalších 30 s. Nové jamky znatelně menší než růstové. Zvětšení 100×.

sledována zároveň i na ploše (111), která je kolmá k optické ose krystalu. Vzorky byly získány ze štěpných tváří leštěním na vlhké tkanině, orientace začíná mikroskopu. Pro tuto plochu bylo třeba nalezt jiné leptadlo. Jako nejvhodnější se ukázal nasycený roztok  $\text{NaNO}_3$  v metanolu s dodáním asi 1 kapky nasyceného roztoku  $\text{CoSO}_4$  v metanolu na 5 ml základního roztoku. Doba leptání je rovněž asi 30 s. Leptové jamky mají tvar rovnostranných trojúhelníků (obr. 7).

Po naleptání byly krystaly oplachovány v čistém butanolu a sušeny filtračním papírem a proudem studeného vzduchu. Pro obě plochy byl nalezen leštěcí roztok, který rozpouští rovnoměrně celou plochu. Pro plochu (100) to byl 26 % roztok  $\text{H}_2\text{O}$  v metanolu, s rychlosťí rozpouštění asi 1,1  $\mu/\text{s}$ , pro plochu (111) čistý metanol s rychlosťí asi 0,3  $\mu/\text{s}$ .

## ZÁVĚR

1. Bylo nalezeno vhodné leptadlo, zviditelnjující východy dislokací na povrch krystalu, a to pro štěpné plochy (100) a pro basální plochy (111).
2. Dokázáno, že leptové jamky skutečně přísluší dislokacím.
3. Leptadlo rozlišuje mezi růstovými a čerstvými dislokacemi.
4. Pro obě plochy byly nalezeny i vhodné leštěcí roztoky.



## LITERATURA

- [1] Регел Б. Р., Урусовская А. А., Коломийчук В. Н., Кристаллография 4 (1959), 937.
- [2] Cabrera N. et al., Phys. Rev. 96 (1954), 1153.
- [3] Cabrera N., J. Chin. Phys. 53 (1956), 675.
- [4] Cabrera N., Levin M. M., Phil. Mag. I (1956), 140.
- [5] Hirth J. P., Pound G. M., Acta Met. 5 (1957), 649.
- [6] Gilman J. J., Johnston W. G., J. Appl. Phys. 29 (1958), 5, 47.
- [7] Amelinckx S., Phil. Mag. I (1956), 269.
- [8] Урусовская А. А., Кристаллография 3 (1958), 4.
- [9] Рожаинский В. Н. et al., Сборник Физика и теплофизика отдельных кристаллов, Рига 1962, 453.
- [10] Костин Н. Ф. et al., Кристаллография 6 (1961), 737.
- [11] Perinová M., bude publikováno.
- [12] Keith R. E., Gilman J. J., Acta Met. 8 (1960), 1.

Došlo 7. 3. 1967

Fyzikálny ústav SAV,  
Bratislava

## VISUALIZATION OF DISLOCATIONS BY ETCHING IN SINGLE CRYSTALS OF NaNO<sub>3</sub>

Milena Perinová

### Summary

The composition of solutions as well as procedures suitable for polishing and etching of the (100) cleavage and the (111) basal planes of NaNO<sub>3</sub> single crystals are given. It is shown that etch-pits belong to the intersection points of dislocation lines with surfaces and that it is possible to distinguish between growth and fresh dislocations.